

8k-TV 技術にも対応した高移動度酸化物半導体用スパッタリングターゲット材 **(製品名 : KOS-B03C) の上市について**

株式会社コベルコ科研（株式会社神戸製鋼所の100%出資子会社）は、8k-TVなどの次世代高精細大型フラットパネルディスプレイの用途に適した高電子移動度酸化物半導体用スパッタリングターゲット材（KOS-B03C）を上市いたしました。

昨今、酸化物半導体層にIGZO（In-Ga-Zn-O）を用いたパネルが生産されておりますが、タブレット、ノートPC、8k-TV、車載などの大型パネルにおいては、高機能化のため電子の移動度をさらに高める必要があり、また主流となっているCu配線プロセスとの組み合わせにて、コスト的に優位性のあるBCE構造(Backchannel-etch)を実現する必要があるなど、パネルメーカーから既存のIGZOをさらに進化させたターゲット材が強く求められておりました。

当社は電子移動度が既存のIGZOの2～3倍、大型パネルに求められるCu配線プロセス及びBCE構造対応が可能な高電子移動度材（KOS-B03C）を、パネルメーカーでのご評価を進めながらターゲット材の量産体制を整備し、上市いたしました。KOS-B03Cの特長は以下の通りです。

1) 電子移動度が既存のIGZOの2～3倍

薄膜トランジスタ（TFT）の小型化によるディスプレイの高精細化、高開口率化、駆動速度向上、低省電力化が期待され、モバイルから8k-TVまで様々な用途展開が可能で、将来のGOA（Gate on array）化も可能。

2) Al配線のみならずCu配線においてもBCE-TFTが実現可能

高精細中小型から大型テレビまでBCE構造が実現可能な高い汎用性があり、薄膜トランジスタ製造プロセスの低コスト化に貢献。

3) 大型スパッタリングターゲット製作が可能

最先端の11世代型ターゲットや円筒形ターゲットの供給にも対応。

当社ではKOS-B03Cを既存のIGZOに次ぐ高電子移動度酸化物半導体として多くのパネルメーカーにご採用いただけるよう進めて参りたいと考えております。

なお、本技術は第25回ディスプレイ国際ワークショップ（IDW'18）（2018/12/12-14：名古屋国際会議場 講演番号：AMD8-4L）にて発表を行い、大きな反響をいただきました。

<本リリースに関するお問い合わせ先>

総務部 広報担当

TEL : 078-272-5915